

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 12 月 8 日 (08.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/116767 A1

(51) 国際特許分類⁷: G03F 7/039, 7/004, 7/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/007274

(22) 国際出願日: 2004 年 5 月 27 日 (27.05.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社シンク・ラボラトリー (THINK LABORATORY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2778525 千葉県柏市高田 1 2 0 1-1 1 Chiba (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 勉 (SATO, Tsutomu) [JP/JP]; 〒2778525 千葉県柏市高田

1 2 0 1-1 1 株式会社シンク・ラボラトリー内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 石原 韶二 (ISHIHARA, Shoji); 〒1700013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 7 番 8 号 若井ビル 3 0 2 号 Tokyo (JP).

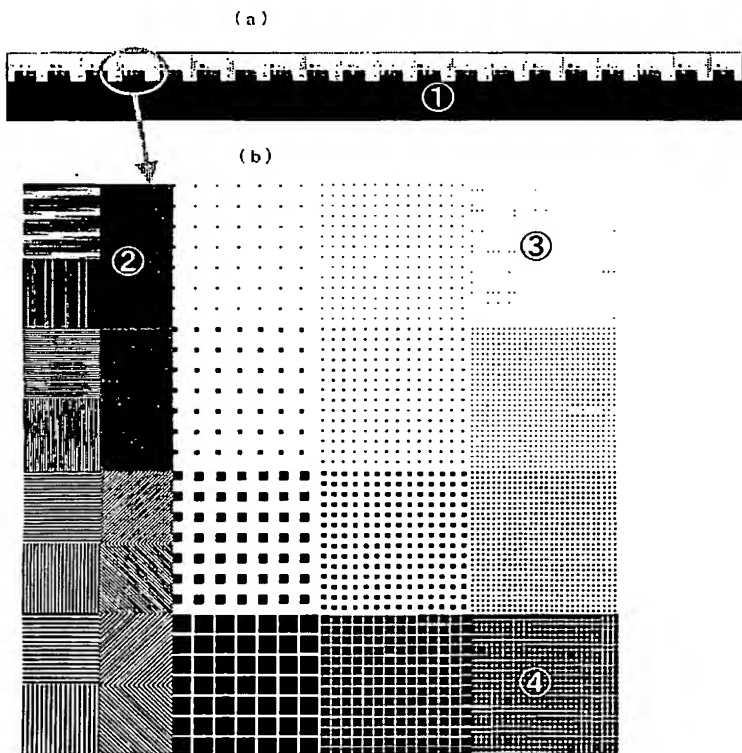
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: POSITIVE PHOTSENSITIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: ポジ型感光性組成物



(57) Abstract: A positive photosensitive composition which comprises (A) an alkali-soluble organic polymer substance having a phenolic hydroxyl group, (B) a light-heat conversion substance absorbing an infrared ray of an image exposure light source and converting it to heat, (C) at least one resin selected from the group consisting of a vinyl pyrrolidone/vinyl acetate copolymer and other specific polymers or resins, and (D) a dissolution inhibiting agent. The positive photosensitive composition does not require burning, provides necessary and sufficient adhesion in an application under a condition of a humidity in a working room of 25 to 60 %, allows the development which retains high sensitivity and is free of a residue, forms an image having a sharp outline, and provides a resist film which is so hard that its resistance to flawing is improved in the handling before development.

(57) 要約: パーニング不要で作業室内の湿度が 25 ~ 60 % の条件で塗布して必要な密着性が得られ、高感度が保たれ残渣が生じない現像ができて、シャープな輪郭で切れ、レジスト膜が非常に硬くて現像前の取り扱いにおける耐傷性が向上するポジ型感光性組成物を提供する。

フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性有機高分子物質 (A)、画像露光光源の赤外線を吸収して熱に変換する光熱変換物質 (B)、(1) ビニルピロリドン/酢酸ビニルコポリマー等からなる群から選択される少なくとも 1 種の樹脂 (C)、及び溶解阻止剤 (D) を含有するようにした。



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。